

10/807391

## PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number : 2001-329217

(43)Date of publication of application : 27.11.2001

(51)Int.Cl.

C09D183/04  
C01B 33/12  
C08G 77/02  
C08G 77/24  
C08G 77/50  
C09D183/02  
C09D183/14  
H01L 21/312  
H01L 21/316

(21)Application number : 2000-150364

(22)Date of filing : 22.05.2000

(71)Applicant : JSR CORP

(72)Inventor : NISHIKAWA MICHINORI  
HASEGAWA KOICHI  
HAYASHI EIJI  
YAMADA KINJI

## (54) FILM-FORMING COMPOSITION, METHOD FOR FORMING FILM AND SILICA FILM

## (57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To produce a film-forming composition capable of forming a silica film having a small difference in relative dielectric constant that varies depending on calcinating conditions and having excellent crack resistance as material for forming an interlaminar insulating film in a semiconductor element or the like.

SOLUTION: The film-forming composition comprises (A) a hydrolyzed condensate produced by subjecting at least one silane compound selected from the group consisting of (A-1) a compound represented by the following formula 1 (A-2) a compound represented by the following formula 2 and (A-3) a compound represented by the following formula 3 to hydrolysis and condensation reaction, (B) a silylating agent and (C) organic solvent:  $R_a(Si)(OR)_4-a$  1,  $Si(OR)_2R_4$  2,  $R_3b(R_4O)_3-bSi-(R_7)_3-c(OR_5)_3-cR_6c$  3, (wherein R denotes H, F or a monovalent organic group; R1 to R6 each denote a monovalent organic group; R7 denotes O, a phenylene group or  $-(CH_2)_n-$ ; a denotes an integer of 1 or 2; b and c each denote a number of 0 to 2; d denotes 0 or 1; and n denotes an integer of 1 to 6).

## LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C), 1998,2003 Japan Patent Office

**THIS PAGE BLANK (USPTO)**

(19) 日本国特許庁 (J P)

(12) 公開特許公報 (A)

(11) 特許出願公開番号

特開2001-329217

(P2001-329217A)

(43) 公開日 平成13年11月27日 (2001. 11. 27)

(51) Int.Cl. <sup>7</sup>	識別記号	F I	テマコード* (参考)
C 0 9 D 1 8 3 / 0 4		C 0 9 D 1 8 3 / 0 4	4 G 0 7 2
C 0 1 B 3 3 / 1 2		C 0 1 B 3 3 / 1 2	C 4 J 0 3 5
C 0 8 G 7 7 / 0 2		C 0 8 G 7 7 / 0 2	4 J 0 3 8
7 7 / 2 4		7 7 / 2 4	5 F 0 5 8
7 7 / 5 0		7 7 / 5 0	
審査請求 未請求 請求項の数 5 O L (全 15 頁) 最終頁に続く			

(21) 出願番号	特願2000-150364 (P2000-150364)	(71) 出願人	000004178 ジェイエスアール株式会社 東京都中央区築地2丁目11番24号
(22) 出願日	平成12年5月22日 (2000. 5. 22)	(72) 発明者	西川 通則 東京都中央区築地2丁目11番24号ジェイエスアール株式会社内
		(72) 発明者	長谷川 公一 東京都中央区築地2丁目11番24号ジェイエスアール株式会社内
		(72) 発明者	林 英治 東京都中央区築地2丁目11番24号ジェイエスアール株式会社内
		最終頁に続く	

(54) 【発明の名称】 膜形成用組成物、膜の形成方法およびシリカ系膜

(57) 【要約】 (修正有)

【課題】 半導体素子などにおける層間絶縁膜材料として、焼成条件による比誘電率の差異が小さく、かつクラック耐性に優れたシリカ系膜が形成可能な膜形成用組成物を得る。

【解決手段】 (A) (A-1)、(A-2)、(A-3) それぞれ下記式1、2、3で表される化合物の群から選ばれた少なくとも一種のシラン化合物を加水分解し、縮合した縮合物、(B) シリル化剤ならびに (C) 有機溶媒を含有することを特徴とする膜形成用組成物。

$R^a (Si) (OR^1)_4 - a \cdots \cdots 1$

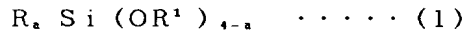
$Si (OR^2)_4 \cdots \cdots 2$

$R^3 - (R^4 O)_b - Si - (R^7)_c - Si (OR^5)_d - R^6 \cdots \cdots 3$

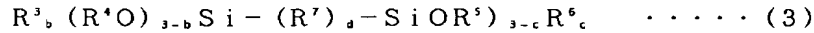
(式中RはH、F、又は一価の有機基、 $R^1 \sim R^6$ は一価の有機基、 $R^7$ はO、フェニレン基又は $-(CH_2)_n-$ 、aは1~2の整数、b、cは0~2の数、dは0または1、nは1~6の整数を示す。)

【特許請求の範囲】

【請求項1】 (A) (A-1) 下記一般式(1)で表される化合物、



(式中、Rは水素原子、フッ素原子または1価の有機 \*



〔式中、 $R^3 \sim R^6$  は同一または異なり、それぞれ1価の有機基、 $b \sim c$  は同一または異なり、0～2の整数、 $R^7$  は酸素原子、フェニレン基または $-(\text{CH}_2)_n-$ で表される基(ここで、 $n$ は1～6の整数である)、 $d$ は0または1を示す。〕の群から選ばれた少なくとも1種の化合物を加水分解、縮合して得られる加水分解縮合物、

(B) シリル化剤ならびに

(C) 有機溶媒を含有することを特徴とする膜形成用組成物。

【請求項2】 (A) 成分がアルカリ触媒の存在下に加水分解、縮合されたものであることを特徴とする請求項1記載の膜形成用組成物。

【請求項3】 (B) 成分の使用量が、(A) 成分10重量部(完全加水分解縮合物換算)に対して0.01～20重量部であることを特徴とする請求項1記載の膜形成用組成物。

【請求項4】 請求項1～3項記載の膜形成用組成物を基板に塗布し、加熱することを特徴とする膜の形成方法。

【請求項5】 請求項4記載の膜の形成方法によって得られるシリカ系膜。

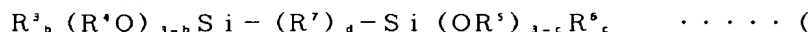
【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】本発明は、膜形成用組成物に関し、さらに詳しくは、半導体素子などにおける層間絶縁膜材料として、焼成条件による比誘電率の差異が小さく、かつクラック耐性に優れたシリカ系膜が形成可能な膜形成用組成物に関する。

【0002】

【従来の技術】従来、半導体素子などにおける層間絶縁膜として、CVD法などの真空プロセスで形成されたシリカ( $\text{SiO}_2$ )膜が多用されている。そして、近年、より均一な層間絶縁膜を形成することを目的として、SOG(Spin on Glass)膜と呼ばれるテトラアルコキシシランの加水分解生成物を主成分とする塗布型の絶縁膜も使用されるようになってきている。また、半導体素子などの高集積化に伴い、有機SOGと呼ばれるボ※



3)

〔式中、 $R^3 \sim R^6$  は同一または異なり、それぞれ1価の有機基、 $b \sim c$  は同一または異なり、0～2の整数、 $R^7$  は酸素原子、フェニレン基または $-(\text{CH}_2)_n-$ で表される基(ここで、 $n$ は1～6の整数である)、 $d$

\*基、 $R^1$  は1価の有機基、 $a$ は1～2の整数を示す。)

(A-2) 下記一般式(2)で表される化合物および



(式中、 $R^2$  は1価の有機基を示す。)

(A-3) 下記一般式(3)で表される化合物

※リオルガノシロキサンを主成分とする低比誘電率の層間絶縁膜が開発されている。特に半導体素子などのさらなる高集積化や多層化に伴い、より優れた導体間の電気絶縁性が要求されており、したがって、より低比誘電率でかつクラック耐性に優れた層間絶縁膜材料が求められるようになっている。

【0003】低比誘電率の材料としては、アンモニアの存在下にアルコキシシランを縮合して得られる微粒子とアルコキシシランの塩基性部分加水分解物との混合物からなる組成物(特開平5-263045、同5-315319)や、ポリアルコキシシランの塩基性加水分解物をアンモニアの存在下縮合することにより得られた塗布液(特開平11-340219、同11-34022

0)が提案されているが、これらの方法で得られる材料は、反応の生成物の性質が安定せず、焼成条件による比誘電率の差異が小さい、クラック耐性などの膜特性のバラツキも大きいため、工業的生産には不向きであった。

【0004】

【発明が解決しようとする課題】本発明は、上記問題点を解決するための膜形成用組成物に関し、さらに詳しくは、半導体素子などにおける層間絶縁膜として、焼成条件による比誘電率の差異が小さく、かつクラック耐性に優れた膜形成用組成物および該組成物から得られるシリカ系膜を提供することを目的とする。

【0005】

【課題を解決するための手段】本発明は、(A) (A-1) 下記一般式(1)で表される化合物(以下、「化合物(1)」という)、



(式中、Rは水素原子、フッ素原子または1価の有機基、 $R^1$  は1価の有機基、 $a$ は1～2の整数を示す。)

(A-2) 下記一般式(2)で表される化合物(以下、「化合物(2)」という)および



(式中、 $R^2$  は1価の有機基を示す。)

(A-3) 下記一般式(3)で表される化合物(以下、「化合物(3)」という)

は0または1を示す。〕の群から選ばれた少なくとも1種の化合物を加水分解、縮合して得られる加水分解縮合物

(B) シリル化剤ならびに

(C)有機溶媒を含有することを特徴とする膜形成用組成物に関する。次に、本発明は、上記膜形成用組成物を基板に塗布し、加熱することを特徴とする膜の形成方法に関する。次に、本発明は、上記膜の形成方法によって得られるシリカ系膜に関する。

#### 【0006】

【発明の実施の形態】本発明において、(A)加水分解縮合物とは、上記化合物(1)～(3)の群から選ばれた少なくとも1種の加水分解物および/またはその縮合物である。ここで、(A)成分における加水分解物とは、上記(A)成分を構成する化合物(1)～(3)に含まれるR<sup>1</sup>-O-基、R<sup>2</sup>-O-基、R<sup>3</sup>-O-基およびR<sup>4</sup>-O-基のすべてが加水分解されている必要はなく、例えば、1個だけが加水分解されているもの、2個以上が加水分解されているもの、あるいは、これらの混合物であってもよい。また、(A)成分における縮合物は、

(A)成分を構成する化合物(1)～(3)の加水分解物のシラノール基が縮合してSi-O-Si結合を形成したものであるが、本発明では、シラノール基がすべて縮合している必要はなく、僅かな一部のシラノール基が縮合したもの、縮合の程度が異なっているものの混合物などをも包含した概念である。

#### 【0007】(A)加水分解縮合物

(A)加水分解縮合物は、上記化合物(1)～(3)の群から選ばれた少なくとも1種のシラン化合物を(B)成分の存在下に、加水分解、縮合して得られる。

化合物(1)；上記一般式(1)において、RおよびR<sup>1</sup>の1価の有機基としては、アルキル基、アリール基、アリル基、グリンジル基などを挙げることができる。また、一般式(1)において、Rは1価の有機基、特にアルキル基またはフェニル基であることが好ましい。ここで、アルキル基としては、メチル基、エチル基、プロピル基、ブチル基などが挙げられ、好ましくは炭素数1～5であり、これらのアルキル基は鎖状でも、分岐していてもよく、さらに水素原子がフッ素原子などに置換されていてもよい。一般式(1)において、アリール基としては、フェニル基、ナフチル基、メチルフェニル基、エチルフェニル基、クロロフェニル基、プロモフェニル基、フルオロフェニル基などを挙げることができる。

【0008】一般式(1)で表される化合物の具体例としては、トリメトキシシラン、トリエトキシシラン、トリ-n-プロポキシシラン、トリ-i-so-プロポキシシラン、トリ-n-ブトキシシラン、トリ-sec-ブトキシシラン、トリ-tert-ブトキシシラン、トリフェノキシシラン、フルオロトリメトキシシラン、フルオロトリエトキシシラン、フルオロトリ-n-プロポキシシラン、フルオロトリ-i-so-プロポキシシラン、フルオロトリ-n-ブトキシシラン、フルオロトリ-sec-ブトキシシラン、フルオロトリ-tert-ブトキシシラン、フルオロトリフェノキシシランなど；

【0009】メチルトリメトキシシラン、メチルトリエトキシシラン、メチルトリ-n-プロポキシシラン、メチルトリ-i-so-プロポキシシラン、メチルトリ-n-ブトキシシラン、メチルトリ-sec-ブトキシシラン、メチルトリ-tert-ブトキシシラン、メチルトリフェノキシシラン、エチルトリメトキシシラン、エチルトリエトキシシラン、エチルトリ-n-プロポキシシラン、エチルトリ-i-so-プロポキシシラン、エチルトリ-n-ブトキシシラン、エチルトリ-sec-ブトキシシラン、エチルトリ-tert-ブトキシシラン、エチルトリフェノキシシラン、ビニルトリメトキシシラン、ビニルトリエトキシシラン、ビニルトリ-n-プロポキシシラン、ビニルトリ-i-so-プロポキシシラン、ビニルトリ-n-ブトキシシラン、ビニルトリ-sec-ブトキシシラン、ビニルトリ-tert-ブトキシシラン、ビニルトリフェノキシシラン、n-プロピルトリメトキシシラン、n-プロピルトリエトキシシラン、n-プロピルトリ-n-プロポキシシラン、n-プロピルトリ-i-so-プロポキシシラン、n-プロピルトリ-n-ブトキシシラン、n-プロピルトリ-sec-ブトキシシラン、n-プロピルトリ-tert-ブトキシシラン、n-プロピルトリフェノキシシラン、i-プロピルトリメトキシシラン、i-プロピルトリエトキシシラン、i-プロピルトリ-n-プロポキシシラン、i-プロピルトリ-i-so-プロポキシシラン、i-プロピルトリ-n-ブトキシシラン、i-プロピルトリ-sec-ブトキシシラン、i-プロピルトリ-tert-ブトキシシラン、i-プロピルトリフェノキシシラン、n-ブチルトリメトキシシラン、n-ブチルトリエトキシシラン、n-ブチルトリ-n-プロポキシシラン、n-ブチルトリ-i-so-プロポキシシラン、n-ブチルトリ-n-ブトキシシラン、n-ブチルトリ-sec-ブトキシシラン、n-ブチルトリ-tert-ブトキシシラン、n-ブチルトリフェノキシシラン、sec-ブチルトリメトキシシラン、sec-ブチルトリエトキシシラン、sec-ブチルトリ-n-プロポキシシラン、sec-ブチルトリ-i-so-プロポキシシラン、sec-ブチルトリ-n-ブトキシシラン、sec-ブチルトリ-sec-ブトキシシラン、sec-ブチルトリ-tert-ブトキシシラン、sec-ブチルトリフェノキシシラン、t-ブチルトリメトキシシラン、t-ブチルトリエトキシシラン、t-ブチルトリ-n-プロポキシシラン、t-ブチルトリ-i-so-プロポキシシラン、t-ブチルトリ-n-ブトキシシラン、t-ブチルトリ-sec-ブトキシシラン、t-ブチルトリ-tert-ブトキシシラン、t-ブチルトリフェノキシシラン、フェニルトリメトキシシラン、フェニルトリエトキシシラン、フェニルトリ-n-プロポキシシラン、フェニルトリ-i-so-プロポキシシラン、フェニルトリ-n-ブトキシシラン、フェニルトリ

-sec-プトキシシラン、フェニルトリ-tert-  
プトキシシラン、フェニルトリフェノキシシラン、ビニ  
ルトリメトキシシラン、ビニルトリエトキシシラン、 $\gamma$ -  
アミノプロピルトリメトキシシラン、 $\gamma$ -アミノプロ  
ピルトリエトキシシラン、 $\gamma$ -グリシドキシプロピルト  
リメトキシシラン、 $\gamma$ -グリシドキシプロピルトリエト  
キシシラン、 $\gamma$ -トリフロロプロピルトリメトキシシラ  
ン、 $\gamma$ -トリフロロプロピルトリエトキシシランなど；

【0010】ジメチルジメトキシシラン、ジメチルジエ  
トキシシラン、ジメチル-ジ-n-プロボキシシラン、  
ジメチル-ジ-iso-プロボキシシラン、ジメチル-  
ジ-n-プトキシシラン、ジメチル-ジ-sec-プト  
キシシラン、ジメチル-ジ-tert-プトキシシラ  
ン、ジメチルジフェノキシシラン、ジエチルジメトキシ  
シラン、ジエチルジエトキシシラン、ジエチル-ジ-n-  
プロボキシシラン、ジエチル-ジ-iso-プロボキシ  
シラン、ジエチル-ジ-n-プトキシシラン、ジエチ  
ル-ジ-sec-プトキシシラン、ジエチル-ジ-tert-  
プトキシシラン、ジエチルジフェノキシシラン、  
ジ-n-プロピルジメトキシシラン、ジ-n-プロピル  
ジエトキシシラン、ジ-n-プロピル-ジ-n-プロボ  
キシシラン、ジ-n-プロピル-ジ-iso-プロボキシ  
シラン、ジ-n-プロピル-ジ-n-プトキシシラ  
ン、ジ-n-プロピル-ジ-sec-プトキシシラン、  
ジ-n-プロピル-ジ-tert-プトキシシラン、ジ-  
n-プロピル-ジ-フェノキシシラン、ジ-iso-  
プロピルジメトキシシラン、ジ-iso-プロピルジエ  
トキシシラン、ジ-iso-プロピル-ジ-n-プロボ  
キシシラン、ジ-iso-プロピル-ジ-iso-プロ  
ボキシシラン、ジ-iso-プロピル-ジ-n-プトキ  
シシラン、ジ-iso-プロピル-ジ-sec-プトキ  
シシラン、ジ-iso-プロピル-ジ-tert-プト  
キシシラン、ジ-iso-プロピル-ジ-フェノキシシ  
ラン、ジ-n-ブチルジメトキシシラン、ジ-n-ブチ  
ルジエトキシシラン、ジ-n-ブチル-ジ-n-プロボ  
キシシラン、ジ-n-ブチル-ジ-iso-プロボキシ  
シラン、ジ-n-ブチル-ジ-n-プトキシシラン、ジ-  
n-ブチル-ジ-sec-プトキシシラン、ジ-n-  
ブチル-ジ-tert-プトキシシラン、ジ-n-ブチ  
ル-ジ-フェノキシシラン、ジ-sec-ブチルジメト  
キシシラン、ジ-sec-ブチルジエトキシシラン、ジ-  
sec-ブチル-ジ-n-プロボキシシラン、ジ-sec-  
ブチル-ジ-iso-プロボキシシラン、ジ-sec-  
ブチル-ジ-n-プトキシシラン、ジ-sec-ブ  
チル-ジ-tert-プトキシシラン、ジ-sec-ブ  
チル-ジ-フェノキシシラン、ジ-tert-ブチルジ  
メトキシシラン、ジ-tert-ブチルジエトキシシラ  
ン、ジ-tert-ブチル-ジ-n-プロボキシシラ  
ン、ジ-tert-ブチル-ジ-iso-プロボキシシ

ラン、ジ-tert-ブチル-ジ-n-プトキシシラ  
ン、ジ-tert-ブチル-ジ-sec-プトキシシラ  
ン、ジ-tert-ブチル-ジ-tert-プトキシシ  
ラン、ジ-tert-ブチル-ジ-フェノキシシラン、  
ジフェニルジメトキシシラン、ジフェニル-ジ-エトキ  
シシラン、ジフェニル-ジ-n-プロボキシシラン、ジ  
フェニル-ジ-iso-プロボキシシラン、ジフェニル  
-ジ-n-プトキシシラン、ジフェニル-ジ-sec-  
プトキシシラン、ジフェニル-ジ-tert-プトキシ  
シラン、ジフェニルジフェノキシシラン、ジビニルトリ  
メトキシシランなど；を挙げることができる。

【0011】化合物(1)として好ましい化合物は、メ  
チルトリメトキシシラン、メチルトリエトキシシラン、  
メチルトリ-n-プロボキシシラン、メチルトリ-iso-  
プロボキシシラン、エチルトリメトキシシラン、エ  
チルトリエトキシシラン、ビニルトリメトキシシラン、  
フェニルトリエトキシシラン、ジメチルジメトキシ  
シラン、ジメチルジエトキシシラン、ジエチルジメトキ  
シシラン、ジエチルジエトキシシラン、ジフェニルジメ  
トキシシラン、ジフェニルジエトキシシランなどであ  
る。これらは、1種あるいは2種以上を同時に使用して  
もよい。

【0012】化合物(2)；上記一般式(2)におい  
て、 $R^2$  で表される1価の有機基としては、先の一般式  
(1)と同様な有機基を挙げることができる。一般式  
(2)で表される化合物の具体例としては、テトラメト  
キシシラン、テトラエトキシシラン、テトラ-n-プロ  
ボキシシラン、テトラ-iso-プロボキシシラン、テ  
トラ-n-プトキシシラン、テトラ-sec-プトキシシ  
ラン、テトラ-tert-プトキシシラン、テトラフェ  
ノキシシランなどが挙げられる。

【0013】化合物(3)；上記一般式(3)におい  
て、 $R^3 \sim R^6$  で表される1価の有機基としては、先の  
一般式(1)と同様な有機基を挙げることができる。一  
般式(3)のうち、 $R^7$  が酸素原子の化合物としては、  
ヘキサメトキシジシロキサン、ヘキサエトキシジシロキ  
サン、ヘキサフェノキシジシロキサン、1, 1, 1, 3,  
3-ペンタメトキシ-3-メチルジシロキサン、  
1, 1, 1, 3, 3-ペンタエトキシ-3-メチルジシ  
ロキサン、1, 1, 1, 3, 3-ペンタフェノキシ-3-  
メチルジシロキサン、1, 1, 1, 3, 3-ペンタメ  
トキシ-3-エチルジシロキサン、1, 1, 1, 3, 3-  
ペンタエトキシ-3-エチルジシロキサン、1, 1, 1,  
1, 3, 3-ペンタフェノキシ-3-エチルジシロキサ  
ン、1, 1, 1, 1, 3, 3-ペンタメトキシ-3-フェニ  
ルジシロキサン、1, 1, 1, 1, 3, 3-ペンタエトキシ  
-3-フェニルジシロキサン、1, 1, 1, 1, 3, 3-ペ  
ンタフェノキシ-3-フェニルジシロキサン、1, 1,  
3, 3-テトラメトキシ-1, 3-ジメチルジシロキサ

ン、1, 1, 3, 3-テトラエトキシ-1, 3-ジメチルジシロキサン、1, 1, 3, 3-テトラフェノキシ-1, 3-ジメチルジシロキサン、1, 1, 3, 3-テトラメトキシ-1, 3-ジエチルジシロキサン、1, 1, 3, 3-テトラエトキシ-1, 3-ジエチルジシロキサン、1, 1, 3, 3-テトラフェノキシ-1, 3-ジエチルジシロキサン、1, 1, 3, 3-テトラメトキシ-1, 3-ジフェニルジシロキサン、1, 1, 3, 3-テトラエトキシ-1, 3-ジフェニルジシロキサン、1, 1, 3, 3-テトラフェノキシ-1, 3-ジフェニルジシロキサン、1, 1, 3-トリメトキシ-1, 3, 3-トリメチルジシロキサン、1, 1, 3-トリエトキシ-1, 3, 3-トリメチルジシロキサン、1, 1, 3-トリフェノキシ-1, 3, 3-トリメチルジシロキサン、1, 1, 3-トリエチルジシロキサン、1, 1, 3-トリエトキシ-1, 3, 3-トリエチルジシロキサン、1, 1, 3-トリフェノキシ-1, 3, 3-トリエチルジシロキサン、1, 1, 3-トリメトキシ-1, 3, 3-トリフェニルジシロキサン、1, 1, 3-トリエトキシ-1, 3, 3-トリフェニルジシロキサン、1, 1, 3-トリフェノキシ-1, 3, 3-トリフェニルジシロキサン、1, 3-ジメトキシ-1, 1, 3, 3-テトラメチルジシロキサン、1, 3-ジエトキシ-1, 1, 3, 3-テトラメチルジシロキサン、1, 3-ジメトキシ-1, 1, 3, 3-テトラエチルジシロキサン、1, 3-ジエトキシ-1, 1, 3, 3-テトラエチルジシロキサン、1, 3-ジフェノキシ-1, 1, 3, 3-テトラエチルジシロキサン、1, 3-ジメトキシ-1, 1, 3, 3-テトラフェニルジシロキサン、1, 3-ジエトキシ-1, 1, 3, 3-テトラフェニルジシロキサン、1, 3-ジフェノキシ-1, 1, 3, 3-テトラフェニルジシロキサンなどを挙げることができる。

【0014】これらのうち、ヘキサメトキシジシロキサン、ヘキサエトキシジシロキサン、1, 1, 3, 3-テトラメトキシ-1, 3-ジメチルジシロキサン、1, 1, 3, 3-テトラエトキシ-1, 3-ジメチルジシロキサン、1, 1, 3, 3-テトラメトキシ-1, 3-ジフェニルジシロキサン、1, 3-ジメトキシ-1, 1, 3, 3-テトラメチルジシロキサン、1, 3-ジエトキシ-1, 1, 3, 3-テトラメチルジシロキサン、1, 3-ジメトキシ-1, 1, 3, 3-テトラフェニルジシロキサン、1, 3-ジエトキシ-1, 1, 3, 3-テトラフェニルジシロキサンなどを、好ましい例として挙げることができる。

【0015】また、一般式(3)において、dが0の化合物としては、ヘキサメトキシジシラン、ヘキサエトキシジシラン、ヘキサフェノキシジシラン、1, 1, 1, 2, 2-ペンタメトキシ-2-メチルジシラン、1,

1, 1, 2, 2-ペンタエトキシ-2-メチルジシラン、1, 1, 1, 2, 2-ペンタフェノキシ-2-メチルジシラン、1, 1, 1, 2, 2-ペンタメトキシ-2-エチルジシラン、1, 1, 1, 2, 2-ペンタエトキシ-2-エチルジシラン、1, 1, 1, 2, 2-ペンタフェノキシ-2-エチルジシラン、1, 1, 1, 2, 2-ペンタメトキシ-2-フェニルジシラン、1, 1, 1, 2, 2-ペンタエトキシ-2-フェニルジシラン、1, 1, 1, 2, 2-ペンタフェノキシ-2-フェニルジシラン、1, 1, 2, 2-テトラメトキシ-1, 2-ジメチルジシラン、1, 1, 2, 2-テトラエトキシ-1, 2-ジメチルジシラン、1, 1, 2, 2-テトラフェノキシ-1, 2-ジメチルジシラン、1, 1, 2, 2-テトラメトキシ-1, 2-ジエチルジシラン、1, 1, 2, 2-テトラエトキシ-1, 2-ジエチルジシラン、1, 1, 2, 2-テトラフェノキシ-1, 2-ジエチルジシラン、1, 1, 2, 2-テトラメトキシ-1, 2-ジフェニルジシラン、1, 1, 2, 2-テトラエトキシ-1, 2-ジフェニルジシラン、1, 1, 2, 2-テトラフェノキシ-1, 2-ジフェニルジシラン、1, 1, 2, 2-トリメトキシ-1, 2, 2-トリメチルジシラン、1, 1, 2-トリエトキシ-1, 2, 2-トリメチルジシラン、1, 1, 2-トリフェノキシ-1, 2, 2-トリメチルジシラン、1, 1, 2-トリエチルジシラン、1, 1, 2-トリエトキシ-1, 2, 2-トリエチルジシラン、1, 1, 2-トリフェノキシ-1, 2, 2-トリエチルジシラン、1, 1, 2-トリメトキシ-1, 2, 2-トリフェニルジシラン、1, 1, 2-トリフェノキシ-1, 2, 2-トリフェニルジシラン、1, 2-ジメトキシ-1, 1, 2, 2-テトラメチルジシラン、1, 2-ジエトキシ-1, 1, 2, 2-テトラメチルジシラン、1, 2-ジフェノキシ-1, 1, 2, 2-テトラメチルジシラン、1, 2-ジメトキシ-1, 1, 2, 2-テトラエチルジシラン、1, 2-ジエトキシ-1, 1, 2, 2-テトラエチルジシラン、1, 2-ジフェノキシ-1, 1, 2, 2-テトラエチルジシラン、1, 2-ジメトキシ-1, 1, 2, 2-テトラフェニルジシラン、1, 2-ジエトキシ-1, 1, 2, 2-テトラフェニルジシラン、1, 2-ジフェノキシ-1, 1, 2, 2-テトラフェニルジシランなどを挙げることができる。

【0016】これらのうち、ヘキサメトキシジシラン、ヘキサエトキシジシラン、1, 1, 2, 2-テトラメトキシ-1, 2-ジメチルジシラン、1, 1, 2, 2-テトラエトキシ-1, 2-ジメチルジシラン、1, 1, 2, 2-テトラメトキシ-1, 2-ジフェニルジシラン、1, 2-ジメトキシ-1, 1, 2, 2-テトラメチルジシラン、1, 2-ジエトキシ-1, 1, 2, 2-テ

トラメチルジシラン、1, 2-ジメトキシ-1, 1, 2, 2-テトラフェニルジシラン、1, 2-ジエトキシ-1, 1, 2, 2-テトラフェニルジシランなどを、好ましい例として挙げることができる。

【0017】さらに、一般式(3)において、R<sup>7</sup> が-(CH<sub>2</sub>)<sub>n</sub>で表される基の化合物としては、ビス(トリメトキシシリル)メタン、ビス(トリエトキシシリル)メタン、ビス(トリ-n-プロポキシシリル)メタン、ビス(トリ-i-プロポキシシリル)メタン、ビス(トリ-n-ブトキシシリル)メタン、ビス(トリ-sec-ブトキシシリル)メタン、ビス(トリ-t-ブトキシシリル)メタン、1, 2-ビス(トリメトキシシリル)エタン、1, 2-ビス(トリエトキシシリル)エタン、1, 2-ビス(トリ-n-プロポキシシリル)エタン、1, 2-ビス(トリ-i-プロポキシシリル)エタン、1, 2-ビス(トリ-n-ブトキシシリル)エタン、1, 2-ビス(トリ-sec-ブトキシシリル)エタン、1, 2-ビス(トリ-t-ブトキシシリル)エタン、1-(ジメトキシメチルシリル)-1-(トリメトキシシリル)メタン、1-(ジエトキシメチルシリル)-1-(トリエトキシシリル)メタン、1-(ジ-n-プロポキシメチルシリル)-1-(トリ-n-プロポキシシリル)メタン、1-(ジ-i-プロポキシメチルシリル)-1-(トリ-i-プロポキシシリル)メタン、1-(ジ-n-ブトキシメチルシリル)-1-(トリ-n-ブトキシシリル)メタン、1-(ジ-sec-ブトキシメチルシリル)-1-(トリ-sec-ブトキシシリル)メタン、1-(ジ-t-ブトキシメチルシリル)-1-(トリ-t-ブトキシシリル)メタン、1-(ジメトキシメチルシリル)-2-(トリメトキシシリル)エタン、1-(ジエトキシメチルシリル)-2-(トリエトキシシリル)エタン、1-(ジ-n-プロポキシメチルシリル)-2-(トリ-n-プロポキシシリル)エタン、1-(ジ-i-プロポキシメチルシリル)-2-(トリ-i-プロポキシシリル)エタン、1-(ジ-n-ブトキシメチルシリル)-2-(トリ-n-ブトキシシリル)エタン、1-(ジ-sec-ブトキシメチルシリル)-2-(トリ-sec-ブトキシシリル)エタン、1-(ジ-t-ブトキシメチルシリル)-2-(トリ-t-ブトキシシリル)エタン、ビス(ジメトキシメチルシリル)メタン、ビス(ジエトキシメチルシリル)メタン、ビス(ジ-n-プロポキシメチルシリル)メタン、ビス(ジ-i-プロポキシメチルシリル)メタン、ビス(ジ-n-ブトキシメチルシリル)メタン、ビス(ジ-sec-ブトキシメチルシリル)メタン、ビス(ジ-t-ブトキシメチルシリル)メタン、1, 2-ビス(ジメトキシメチルシリル)エタン、1, 2-ビス(ジエトキシメチルシリル)エタン、1, 2-ビス(ジ-n-プロポキシメチルシリル)エタン、1, 2-ビス(ジ-i-プロポキシメチルシリル)エタン、1, 2-

ビス(ジ-n-ブトキシメチルシリル)エタン、1, 2-ビス(ジ-sec-ブトキシメチルシリル)エタン、1, 2-ビス(ジ-t-ブトキシメチルシリル)エタン、1, 2-ビス(トリメトキシシリル)ベンゼン、1, 2-ビス(トリエトキシシリル)ベンゼン、1, 2-ビス(トリ-n-プロポキシシリル)ベンゼン、1, 2-ビス(トリ-i-プロポキシシリル)ベンゼン、1, 2-ビス(トリ-n-ブトキシシリル)ベンゼン、1, 2-ビス(トリ-sec-ブトキシシリル)ベンゼン、1, 2-ビス(トリ-t-ブトキシシリル)ベンゼン、1, 3-ビス(トリメトキシシリル)ベンゼン、1, 3-ビス(トリエトキシシリル)ベンゼン、1, 3-ビス(トリ-n-プロポキシシリル)ベンゼン、1, 3-ビス(トリ-i-プロポキシシリル)ベンゼン、1, 3-ビス(トリ-n-ブトキシシリル)ベンゼン、1, 3-ビス(トリ-sec-ブトキシシリル)ベンゼン、1, 3-ビス(トリ-t-ブトキシシリル)ベンゼン、1, 4-ビス(トリメトキシシリル)ベンゼン、1, 4-ビス(トリエトキシシリル)ベンゼン、1, 4-ビス(トリ-n-プロポキシシリル)ベンゼン、1, 4-ビス(トリ-i-プロポキシシリル)ベンゼン、1, 4-ビス(トリ-n-ブトキシシリル)ベンゼン、1, 4-ビス(トリ-sec-ブトキシシリル)ベンゼン、1, 4-ビス(トリ-t-ブトキシシリル)ベンゼンなど挙げることができる。

【0018】これらのうち、ビス(トリメトキシシリル)メタン、ビス(トリエトキシシリル)メタン、1, 2-ビス(トリメトキシシリル)エタン、1, 2-ビス(トリエトキシシリル)エタン、1-(ジメトキシメチルシリル)-1-(トリメトキシシリル)メタン、1-(ジエトキシメチルシリル)-1-(トリエトキシシリル)メタン、1-(ジメトキシメチルシリル)-2-(トリメトキシシリル)エタン、1-(ジエトキシメチルシリル)-2-(トリエトキシシリル)エタン、ビス(ジメトキシメチルシリル)メタン、ビス(ジエトキシメチルシリル)メタン、1, 2-ビス(ジメトキシメチルシリル)エタン、1, 2-ビス(ジエトキシメチルシリル)エタン、1, 2-ビス(トリメトキシシリル)ベンゼン、1, 2-ビス(トリエトキシシリル)ベンゼン、1, 3-ビス(トリメトキシシリル)ベンゼン、1, 3-ビス(トリエトキシシリル)ベンゼン、1, 4-ビス(トリメトキシシリル)ベンゼン、1, 4-ビス(トリエトキシシリル)ベンゼンなどを好ましい例として挙げることができる。

【0019】本発明において、(A)成分を構成する化合物(1)~(3)としては、上記化合物(1)、(2)および(3)の1種もしくは2種以上を用いることができる。

【0020】なお、上記(A)成分を構成する化合物(1)~(3)の群から選ばれた少なくとも1種のシラ



ン化合物を加水分解、縮合させる際に、(A)成分1モル当たり20モルを越え150モル以下の水を用いることが好ましく、20モルを越え130モルの水を加えることが特に好ましい。添加する水の量が20モル以下であると塗膜の耐クラック性が劣る場合があり、150モルを越えると加水分解および縮合反応中のポリマーの析出やゲル化が生じる場合がある。

【0021】本発明の(A)加水分解縮合物を製造するに際しては、上記化合物(1)～(3)の群から選ばれた少なくとも1種のシラン化合物を加水分解、縮合させる際に、アルカリ触媒を用いることが特徴である。アルカリ触媒を用いることにより、低比誘電率のシリカ系膜を得ることができる。本発明で使用するこのできるアルカリ触媒としては、例えば、水酸化ナトリウム、水酸化カリウム、水酸化リチウム、ピリジン、ピロール、ピペラジン、ピロリジン、ピペリジン、ピコリン、モノエタノールアミン、ジエタノールアミン、ジメチルモノエタノールアミン、モノメチルジエタノールアミン、トリエタノールアミン、ジアザビスクロオクタン、ジアザビスクロノナン、ジアザビスクロウンデセン、テトラメチルアンモニウムハイドロオキサイド、アンモニア、メチルアミン、エチルアミン、プロピルアミン、ブチルアミン、ペンチルアミン、ヘキシルアミン、ベンチルアミン、オクチルアミン、ノニルアミン、デシルアミン、N,N-ジメチルアミン、N,N-ジエチルアミン、N,N-ジプロピルアミン、N,N-ジブチルアミン、トリメチルアミン、トリエチルアミン、トリプロピルアミン、トリブチルアミン、シクロヘキシルアミン、トリメチルイミジン、1-アミノ-3-メチルブタン、ジメチルグリシン、3-アミノ-3-メチルアミンなどを挙30  
げることができ、より好ましくは有機アミンであり、アンモニア、アルキルアミンおよびテトラメチルアンモニウムハイドロオキサイドがシリカ系膜の基板への密着性の点から特に好ましい。これらのアルカリ触媒は1種あるいは2種以上を同時に使用しても良い。

【0022】上記アルカリ触媒の使用量は、化合物(1)～(3)中の $R^1$ -O-基、 $R^2$ -O-基、 $R^4$ -O-基および $R^5$ -O-基で表される基の総量1モルに対して、通常、0.00001～10モル、好ましくは0.00005～5モルである。アルカリ触媒の使用量が上記範囲内であれば、反応中のポリマーの析出やゲル化の恐れが少ない。

【0023】このようにして得られる(A)加水分解縮合物の慣性半径は、GPC(屈折率、粘度、光散乱測定)法による慣性半径で、好ましくは5～50nm、さらに好ましくは8～40nm、特に好ましくは9～20nmである。加水分解縮合物の慣性半径が5～50nmであると、得られるシリカ系膜の比誘電率、弾性率および膜の均一性に特に優れるものとできる。また、このようにして得られる(A)加水分解縮合物は、粒子状の形

態をとっていないことにより、基板状への塗布性が優れるという特徴を有している。粒子状の形態をとっていないことは、例えば透過型電子顕微鏡観察(TEM)により確認される。

【0024】なお、(A)成分中、各成分を完全加水分解縮合物に換算したときに、化合物(2)は、化合物(1)～(3)の総量中、5～75重量%、好ましくは10～70重量%、さらに好ましくは15～70重量%である。また、化合物(1)および/または(3)は、化合物(1)～(3)の総量中、95～25重量%、好ましくは90～30重量%、さらに好ましくは85～30重量%である。化合物(2)が、化合物(1)～(3)の総量中、5～75重量%であることが、得られる塗膜の弾性率が高く、かつ低誘電性に特に優れる。ここで、本発明において、完全加水分解縮合物とは、化合物(1)～(3)中の $R^1$ -O-基、 $R^2$ -O-基、 $R^4$ -O-基および $R^5$ -O-基が100%加水分解してSiOH基となり、さらに完全に縮合してシロキサン構造となったものをいう。また、(A)成分としては、得られる組成物の貯蔵安定性がより優れるので、化合物(1)および化合物(2)の加水分解縮合物であることが好ましい。

【0025】さらに、(A)加水分解縮合物では、化合物(1)～(3)の群から選ばれた少なくとも1種のシラン化合物を、アルカリ触媒の存在下に加水分解・縮合して、加水分解縮合物とし、好ましくはその慣性半径を5万～1,000万となすが、その後、組成物のpHを7以下に調整することが好ましい。pHを調整する方法としては、

- ① pH調整剤を添加する方法、
- ② 常圧または減圧下で、組成物中よりアルカリ触媒を除去する方法、
- ③ 窒素、アルゴンなどのガスをバブリングすることにより、組成物中からアルカリ触媒を除去する方法、
- ④ イオン交換樹脂により、組成物中からアルカリ触媒を除く方法、
- ⑤ 抽出や洗浄によってアルカリ触媒を系外に除去する方法、などが挙げられる。これらの方法は、それぞれ、組み合わせて用いてもよい。

【0026】ここで、上記pH調整剤としては、無機酸や有機酸が挙げられる。無機酸としては、例えば、塩酸、硝酸、硫酸、フッ酸、リン酸、ホウ酸、シュウ酸などを挙げることができる。また、有機酸としては、例えば、酢酸、プロピオン酸、ブタン酸、ペンタン酸、ヘキサン酸、ヘプタン酸、オクタン酸、ノナン酸、デカン酸、シュウ酸、マレイン酸、メチルマロン酸、アジピン酸、セバシン酸、没食子酸、酪酸、メリット酸、アラキドン酸、シキミ酸、2-エチルヘキサン酸、オレイン酸、ステアリン酸、リノール酸、リノレイン酸、サリチル酸、安息香酸、p-アミノ安息香酸、p-トルエンス

ルホン酸、ベンゼンスルホン酸、モノクロロ酢酸、ジクロロ酢酸、トリクロロ酢酸、トリフルオロ酢酸、ギ酸、マロン酸、スルホン酸、フタル酸、フマル酸、クエン酸、酒石酸、コハク酸、フマル酸、イタコン酸、メサコン酸、シトラコン酸、リンゴ酸、グルタル酸の加水分解物、無水マレイン酸の加水分解物、無水フタル酸の加水分解物などを挙げることができる。これら化合物は、1種あるいは2種以上を同時に使用してもよい。

【0027】上記pH調整剤による組成物のpHは、7以下、好ましくは1〜6に調整される。このように、加水分解縮合物の慣性半径を5万〜1,000万となしたのち、上記pH調整剤により上記範囲内にpHを調整することにより、得られる組成物の貯蔵安定性が向上するという効果が得られる。pH調整剤の使用量は、組成物のpHが上記範囲内となる量であり、その使用量は、適宜選択される。

#### 【0028】(B)成分

本発明に使用する(B)成分としては、例えば、アリロキシトリメチルシラン、N、O-ビス(トリメチルシリル)アセトアミド、ビス(トリメチルシリル)トリフルオロアセトアミド、ビス(トリメチルシリル)尿素、トリメチルクロロシラン、N-(トリメチルシリル)アセトアミド、トリメチルシリルアジド、トリメチルシリルシアナニド、N-(トリメチルシリル)イミダゾール、3-トリメチルシリル-2-オキサゾリジノン、トリメチルシリルトリフルオロメタンスルフォネート、ヘキサメチルジシラザン、ヘプタメチルジシラザン、ヘキサメチルジシロキサン、N-メチル-N-トリメチルシリルトリフルオロアセトアミド、(N、N-ジメチルアミノ)トリメチルシラン、ノナメチルトリシラザン、1,1,3,3-テトラメチルジシラザン、トリメチルヨードシランなどを挙げることができる。

【0029】膜形成用組成物中の(B)成分の資料量は、(A)成分100重量部(完全加水分解縮合物換算)に対して0.01〜20重量部であり、より好ましくは0.02〜10重量部である。(B)成分の使用量が0.01重量部未満であると焼成条件の差異による比誘電率の差異が生じる場合があり、10重量部を越えると溶液の塗布均一性が劣る場合がある。これら(B)成分が2種以上を同時に使用しても良い。

#### 【0030】(C)有機溶媒

本発明の膜形成用組成物は、(A)成分と(B)成分を、通常、(C)有機溶媒に溶解または分散してなる。この(C)有機溶媒としては、アルコール系溶媒、ケトン系溶媒、アミド系溶媒、エステル系溶媒および非プロトン系溶媒の群から選ばれた少なくとも1種が挙げられる。ここで、アルコール系溶媒としては、メタノール、エタノール、n-プロパノール、i-プロパノール、n-ブタノール、i-ブタノール、sec-ブタノール、t-ブタノール、n-ペンタノール、i-ペンタノール、

2-メチルブタノール、sec-ペンタノール、t-ペンタノール、3-メトキシブタノール、n-ヘキサノール、2-メチルペンタノール、sec-ヘキサノール、2-エチルブタノール、sec-ヘプタノール、ヘプタノール-3、n-オクタノール、2-エチルヘキサノール、sec-オクタノール、n-ノニルアルコール、2,6-ジメチルヘプタノール-4、n-デカノール、sec-ウンデシルアルコール、トリメチルノニルアルコール、sec-テトラデシルアルコール、sec-ヘプタデシルアルコール、フェノール、シクロヘキサノール、メチルシクロヘキサノール、3,3,5-トリメチルシクロヘキサノール、ベンジルアルコール、ジアセトンアルコールなどのモノアルコール系溶媒；

【0031】エチレングリコール、1,2-プロピレングリコール、1,3-ブチレングリコール、ペンタンジオール-2,4,2-メチルペンタンジオール-2,4,ヘキサジオール-2,5,ヘプタンジオール-2,4,2-エチルヘキサジオール-1,3,ジエチレングリコール、ジプロピレングリコール、トリエチレングリコール、トリプロピレングリコールなどの多価アルコール系溶媒；エチレングリコールモノメチルエーテル、エチレングリコールモノエチルエーテル、エチレングリコールモノプロピルエーテル、エチレングリコールモノブチルエーテル、エチレングリコールモノヘキシルエーテル、エチレングリコールモノフェニルエーテル、エチレングリコールモノ-2-エチルブチルエーテル、ジエチレングリコールモノメチルエーテル、ジエチレングリコールモノエチルエーテル、ジエチレングリコールモノプロピルエーテル、ジエチレングリコールモノブチルエーテル、ジエチレングリコールモノヘキシルエーテル、プロピレングリコールモノメチルエーテル、プロピレングリコールモノエチルエーテル、プロピレングリコールモノプロピルエーテル、プロピレングリコールモノブチルエーテル、ジプロピレングリコールモノメチルエーテル、ジプロピレングリコールモノエチルエーテル、ジプロピレングリコールモノプロピルエーテルなどの多価アルコール部分エーテル系溶媒；などを挙げることができる。これらのアルコール系溶媒は、1種あるいは2種以上を同時に使用してもよい。

【0032】ケトン系溶媒としては、アセトン、メチルエチルケトン、メチル-n-プロピルケトン、メチル-n-ブチルケトン、ジエチルケトン、メチル-i-ブチルケトン、メチル-n-ペンチルケトン、エチル-n-ブチルケトン、メチル-n-ヘキシルケトン、ジ-i-ブチルケトン、トリメチルノナン、シクロヘキサノン、2-ヘキサノン、メチルシクロヘキサノン、2,4-ペンタンジオン、アセトニルアセトン、アセトフェノン、フェンチオンなどのほか、アセチルアセトン、2,4-ヘキサジオン、2,4-ヘプタンジオン、3,5-ヘプタンジオン、2,4-オクタジオン、3,5-

メチル- $\Delta^3$ -ピロリン、N-メチルピベリジン、N-エチルピベリジン、N, N-ジメチルピベラジン、N-メチルイミダゾール、N-メチル-4-ピベリドン、N-メチル-2-ピベリドン、N-メチル-2-ピロリドン、1, 3-ジメチル-2-イミダゾリジノン、1, 3-ジメチルテトラヒドロ-2 (1 H)-ピリミジノンなどを挙げることができる。

【００３５】本発明の膜形成用組成物は、（Ａ）成分を構成する化合物（１）～（３）を加水分解および／または縮合する際に、同様の溶媒を使用することができる。

【００３６】具体的には、化合物（１）～（３）を溶解させた溶媒中に水または溶媒で希釈した水を断続的あるいは連続的に添加する。この際、アルカリ触媒は溶媒中に予め添加しておいてもよいし、水添加時に水中に溶解あるいは分散させておいてもよい。この際の反応温度としては、通常、０～１００℃、好ましくは１５～９０℃である。

本発明で得られる膜形成用組成物には、さらにコロイド状シリカ、コロイド状アルミナ、有機ポリマー、界面活性剤、シランカップリング剤、ラジカル発生剤、トリアゼン化合物などの成分を添加してもよい。コロイド状シリカとは、例えば、高純度の無水ケイ酸を前記親水性有機溶媒に分散した分散液であり、通常、平均粒径が5～30μm、好ましくは10～20μm、固形分濃度が10～40重量%程度のものである。このような、コロイド状シリカとしては、例えば、日産化学工業（株）製、メタノールシリカゾルおよびイソプロパノールシリカゾル；触媒化成工業（株）製、オスカルなどが挙げられる。コロイド状アルミナとしては、日産化学工業（株）製のアルミナゾル520、同100、同200；川研ファインケミカル（株）製のアルミナクリアーゾル、アルミナゾル10、同132などが挙げられる。有機ポリマーとしては、例えば、糖鎖構造を有する化合物、ビニルアミド系重合体、（メタ）アクリル系重合体、芳香族ビニル化合物、 dendrimer、ポリイミド、ポリアミック酸、ポリアリーレン、ポリアミド、ポリキノキサリン、ポリオキサジアゾール、フッ素系重合体、ポリアルキレンオキサイド構造を有する化合物などを挙げることができる。

【0038】ポリアルキレンオキサイド構造を有する化合物としては、ポリメチレンオキサイド構造、ポリエチレンオキサイド構造、ポリプロピレンオキサイド構造、ポリテトラメチレンオキサイド構造、ポリブチレンオキサイド構造などが挙げられる。具体的には、ポリオキシメチレンアルキルエーテル、ポリオキシエチレンアルキルエーテル、ポリオキシエチレンアルキルフェニルエーテル、ポリオキシエチレンステロールエーテル、ポリオキシエチレンラノリン誘導体、アルキルフェノールホルマリン縮合物の酸化エチレン誘導体、ポリオキシエチレ

ンポリオキシプロピレンブロックポリマー、ポリオキシエチレンポリオキシプロピレンアルキルエーテルなどのエーテル型化合物、ポリオキシエチレングリセリン脂肪酸エステル、ポリオキシエチレンソルビタン脂肪酸エステル、ポリオキシエチレンソルビトール脂肪酸エステル、ポリオキシエチレン脂肪酸アルカノールアミド硫酸塩などのエーテルエステル型化合物、ポリエチレングリコール脂肪酸エステル、エチレングリコール脂肪酸エステル、脂肪酸モノグリセリド、ポリグリセリン脂肪酸エステル、ソルビタン脂肪酸エステル、プロピレングリコール脂肪酸エステル、ショ糖脂肪酸エステルなどのエーテルエステル型化合物などを挙げることができる。ポリオキシチレンポリオキシプロピレンブロックポリマーとしては下記のようなブロック構造を有する化合物が挙げられる。

—(X)<sub>j</sub>—(Y)<sub>k</sub>—

—(X)<sub>j</sub>—(Y)<sub>k</sub>—(X)<sub>l</sub>—

(式中、Xは—CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>O—で表される基を、Yは—CH<sub>2</sub>CH(CH<sub>3</sub>)O—で表される基を示し、jは1～90、kは10～99、lは0～90の数を示す)

これらの中で、ポリオキシエチレンアルキルエーテル、ポリオキシエチレンポリオキシプロピレンブロックポリマー、ポリオキシエチレンポリオキシプロピレンアルキルエーテル、ポリオキシエチレングリセリン脂肪酸エステル、ポリオキシエチレンソルビタン脂肪酸エステル、ポリオキシエチレンソルビトール脂肪酸エステル、などのエーテル型化合物をより好ましい例として挙げることができる。これらは1種あるいは2種以上を同時に使用しても良い。

【0039】界面活性剤としては、例えば、ノニオン系界面活性剤、アニオン系界面活性剤、カチオン系界面活性剤、両性界面活性剤などが挙げられ、さらには、フッ素系界面活性剤、シリコン系界面活性剤、ポリアルキレンオキシド系界面活性剤、ポリ(メタ)アクリレート系界面活性剤などを挙げることができ、好ましくはフッ素系界面活性剤、シリコン系界面活性剤を挙げることができる。

【0040】フッ素系界面活性剤としては、例えば1, 1, 2, 2-テトラフロロオクチル(1, 1, 2, 2-テトラフロロプロピル)エーテル、1, 1, 2, 2-テトラフロロオクチルヘキシルエーテル、オクタエチレングリコールジ(1, 1, 2, 2-テトラフロロブチル)エーテル、ヘキサエチレングリコール(1, 1, 2, 2, 3, 3-ヘキサフロロベンチル)エーテル、オクタプロピレングリコールジ(1, 1, 2, 2-テトラフロロブチル)エーテル、ヘキサプロピレングリコールジ(1, 1, 2, 2, 3, 3-ヘキサフロロベンチル)エーテル、パーフロロデシルスルホン酸ナトリウム、1, 1, 2, 2, 8, 8, 9, 9, 10, 10-デカフロロデカン、1, 1, 2, 2, 3, 3-ヘキサフロロ

デカン、N-[3-(パーフルオロオクタンスルホンアミド)プロピル]-N, N'-ジメチル-N-カルボキシメチレンアンモニウムベタイン、パーフルオロアルキルスルホンアミドプロピルトリメチルアンモニウム塩、パーフルオロアルキル-N-エチルスルホニルグリシン塩、リン酸ビス(N-パーフルオロオクチルスルホニル-N-エチルアミノエチル)、モノパーフルオロアルキルエチルリン酸エステル等の末端、主鎖および側鎖の少なくとも何れかの部位にフルオロアルキルまたはフルオロアルキレン基を有する化合物からなるフッ素系界面活性剤を挙げることができる。また、市販品としてはメガファックF142D、同F172、同F173、同F183(以上、大日本インキ化学工業(株)製)、エフトップEF301、同303、同352(新秋田化成(株)製)、フロラードFC-430、同FC-431(住友スリーエム(株)製)、アサヒガードAG710、サーフロンS-382、同SC-101、同SC-102、同SC-103、同SC-104、同SC-105、同SC-106(旭硝子(株)製)、BM-1000、BM-1100(裕商(株)製)、NBX-15((株)ネオス)などの名称で市販されているフッ素系界面活性剤を挙げることができる。これらの中でも、上記メガファックF172、BM-1000、BM-1100、NBX-15が特に好ましい。

【0041】シリコン系界面活性剤としては、例えばSH7PA、SH21PA、SH30PA、ST94PA(いずれも東レ・ダウコーニング・シリコン(株)製などを用いることが出来る。これらの中でも、上記SH28PA、SH30PAが特に好ましい。

【0042】界面活性剤の使用量は、(A)成分(完全加水分解縮合物)に対して通常0.0001～10重量部である。これらは1種あるいは2種以上を同時に使用しても良い。

【0043】シランカップリング剤としては、例えば3-グリシジロキシプロピルトリメトキシシラン、3-アミノグリシジロキシプロピルトリエトキシシラン、3-メタクリロキシプロピルトリメトキシシラン、3-グリシジロキシプロピルメチルジメトキシシラン、1-メタクリロキシプロピルメチルジメトキシシラン、3-アミノプロピルトリメトキシシラン、3-アミノプロピルトリエトキシシラン、2-アミノプロピルトリメトキシシラン、2-アミノプロピルトリエトキシシラン、N-(2-アミノエチル)-3-アミノプロピルトリメトキシシラン、N-(2-アミノエチル)-3-アミノプロピルメチルジメトキシシラン、3-ウレイドプロピルトリメトキシシラン、3-ウレイドプロピルトリエトキシシラン、N-エトキシカルボニル-3-アミノプロピルトリメトキシシラン、N-エトキシカルボニル-3-アミノプロピルトリエトキシシラン、N-トリエトキシシリルプロピルトリエチレントリアミン、N-トリエトキ

シシリルプロビルトリエチレントリアミン、10-トリメトキシシリル-1, 4, 7-トリアザデカン、10-トリエトキシシリル-1, 4, 7-トリアザデカン、9-トリメトキシシリル-3, 6-ジアザノニルアセテート、9-トリエトキシシリル-3, 6-ジアザノニルアセテート、N-ベンジル-3-アミノプロビルトリメトキシシラン、N-ベンジル-3-アミノプロビルトリエトキシシラン、N-フェニル-3-アミノプロビルトリメトキシシラン、N-フェニル-3-アミノプロビルトリエトキシシラン、N-ビス(オキシエチレン)-3-アミノプロビルトリメトキシシラン、N-ビス(オキシエチレン)-3-アミノプロビルトリエトキシシランなどが挙げられる。これらは1種あるいは2種以上を同時に使用しても良い。

【0044】ラジカル発生剤としては、例えばイソブチルパーオキシド、 $\alpha$ 、 $\alpha'$ ビス(ネオデカノイルパーオキシ)ジイソプロビルベンゼン、クミルパーオキシネオデカノエート、ジ-nプロビルパーオキシジカーボネート、ジイソプロビルパーオキシジカーボネート、1, 1, 3, 3-テトラメチルブチルパーオキシネオデカノエート、ビス(4- $t$ -ブチルシクロヘキシル)パーオキシジカーボネート、1-シクロヘキシル-1-メチルエチルパーオキシネオデカノエート、ジ-2-エトキシエチルパーオキシジカーボネート、ジ(2-エチルヘキシルパーオキシ)ジカーボネート、 $t$ -ヘキシルパーオキシネオデカノエート、ジメトキブチルパーオキシジカーボネート、ジ(3-メチル-3-メトキブチルパーオキシ)ジカーボネート、 $t$ -ブチルパーオキシネオデカノエート、2, 4-ジクロロベンゾイルパーオキシド、 $t$ -ヘキシルパーオキシビバレート、 $t$ -ブチルパーオキシビバレート、3, 5, 5-トリメチルヘキサノイルパーオキシド、オクタノイルパーオキシド、ラウロイルパーオキシド、ステアロイルパーオキシド、1, 1, 3, 3-テトラメチルブチルパーオキシ2-エチルヘキサノエート、スクシニックパーオキシド、2, 5-ジメチル-2, 5-ジ(2-エチルヘキサノイルパーオキシ)ヘキサノ-1-シクロヘキシル-1-メチルエチルパーオキシ2-エチルヘキサノエート、 $t$ -ヘキシルパーオキシ2-エチルヘキサノエート、 $t$ -ブチルパーオキシ2-エチルヘキサノエート、 $m$ -トルオイルアンドベンゾイルパーオキシド、ベンゾイルパーオキシド、 $t$ -ブチルパーオキシイソブチレート、ジ- $t$ -ブチルパーオキシ-2-メチルシクロヘキサン、1, 1-ビス( $t$ -ヘキシルパーオキシ)-3, 3, 5-トリメチルシクロヘキサン、1, 1-ビス( $t$ -ヘキシルパーオキシ)シクロヘキサン、1, 1-ビス( $t$ -ブチルパーオキシ)-3, 3, 5-トリメチルシクロヘキサン、1, 1-ビス( $t$ -ブチルパーオキシ)シクロヘキサン、2, 2-ビス(4, 4-ジ- $t$ -ブチルパーオキシシクロヘキシル)プロパン、1, 1-

ビス( $t$ -ブチルパーオキシ)シクロデカン、 $t$ -ヘキシルパーオキシイソプロビルモノカーボネート、 $t$ -ブチルパーオキシマレイン酸、 $t$ -ブチルパーオキシ-3, 3, 5-トリメチルヘキサノエート、 $t$ -ブチルパーオキシラウレート、2, 5-ジメチル-2, 5-ジ( $m$ -トルオイルパーオキシ)ヘキサノ-1-シクロヘキシルモノカーボネート、 $t$ -ブチルパーオキシ2-エチルヘキシルモノカーボネート、 $t$ -ヘキシルパーオキシベンゾエート、2, 5-ジメチル-2, 5-ジ(ベンゾイルパーオキシ)ヘキサノ-1-シクロヘキシルパーオキシアセテート、2, 2-ビス( $t$ -ブチルパーオキシ)ブタン、 $t$ -ブチルパーオキシベンゾエート、 $n$ -ブチル-4, 4-ビス( $t$ -ブチルパーオキシ)バレレート、ジ- $t$ -ブチルパーオキシイソフタレート、 $\alpha$ 、 $\alpha'$ ビス( $t$ -ブチルパーオキシ)ジイソプロビルベンゼン、ジクミルパーオキシド、2, 5-ジメチル-2, 5-ジ( $t$ -ブチルパーオキシ)ヘキサノ-1-シクロヘキシルパーオキシド、ジ- $t$ -ブチルパーオキシド、 $p$ -メンタンヒドロパーオキシド、2, 5-ジメチル-2, 5-ジ( $t$ -ブチルパーオキシ)ヘキシノ-3, ジイソプロビルベンゼンヒドロパーオキシド、 $t$ -ブチルトリメチルシリルパーオキシド、1, 1, 3, 3-テトラメチルブチルヒドロパーオキシド、クメンヒドロパーオキシド、 $t$ -ヘキシルヒドロパーオキシド、 $t$ -ブチルヒドロパーオキシド、2, 3-ジメチル-2, 3-ジフェニルブタン等を挙げることができる。

【0045】ラジカル発生剤の配合量は、重合体100重量部に対し、0.1~10重量部が好ましい。これらは1種あるいは2種以上を同時に使用しても良い。

【0046】トリアゼン化合物としては、例えば、1, 2-ビス(3, 3-ジメチルトリアゼニル)ベンゼン、1, 3-ビス(3, 3-ジメチルトリアゼニル)ベンゼン、1, 4-ビス(3, 3-ジメチルトリアゼニル)ベンゼン、ビス(3, 3-ジメチルトリアゼニルフェニル)エーテル、ビス(3, 3-ジメチルトリアゼニルフェニル)メタン、ビス(3, 3-ジメチルトリアゼニルフェニル)スルホン、ビス(3, 3-ジメチルトリアゼニルフェニル)スルフィド、2, 2-ビス[4-(3, 3-ジメチルトリアゼニルフェノキシ)フェニル]-1, 1, 1, 3, 3, 3-ヘキサフルオロプロパン、2, 2-ビス[4-(3, 3-ジメチルトリアゼニルフェノキシ)フェニル]プロパン、1, 3, 5-トリス(3, 3-ジメチルトリアゼニル)ベンゼン、2, 7-ビス(3, 3-ジメチルトリアゼニル)-9, 9-ビス[4-(3, 3-ジメチルトリアゼニル)フェニル]フルオレン、2, 7-ビス(3, 3-ジメチルトリアゼニル)-9, 9-ビス[3-メチル-4-(3, 3-ジメチルトリアゼニル)フェニル]フルオレン、2, 7-ビス(3, 3-ジメチルトリアゼニル)-9, 9-ビス

〔3-フェニル-4-(3,3-ジメチルトリアゼニル)フェニル〕フルオレン、2,7-ビス(3,3-ジメチルトリアゼニル)-9,9-ビス〔3-プロペニル-4-(3,3-ジメチルトリアゼニル)フェニル〕フルオレン、2,7-ビス(3,3-ジメチルトリアゼニル)-9,9-ビス〔3-フルオロ-4-(3,3-ジメチルトリアゼニル)フェニル〕フルオレン、2,7-ビス(3,3-ジメチルトリアゼニル)-9,9-ビス〔3,5-ジフルオロ-4-(3,3-ジメチルトリアゼニル)フェニル〕フルオレン、2,7-ビス(3,3-ジメチルトリアゼニル)-9,9-ビス〔3-トリフルオロメチル-4-(3,3-ジメチルトリアゼニル)フェニル〕フルオレンなどが挙げられる。これらは1種あるいは2種以上を同時に使用しても良い。

#### 【0047】膜形成用組成物の調製方法

本発明の膜形成用組成物を調製するに際しては、例えば、溶媒中化合物(1)~(3)を混合して、水を連続的または断続的に添加して、加水分解し、縮合し、(A)成分を調製したのち、これに(D)成分を添加すればよく、特に限定されない。

【0048】本発明の組成物の調製方法の具体例としては、下記1)~14)の方法などを挙げることができる。

1) (A)成分を構成する化合物(1)~(3)、アルカリ触媒および有機溶媒からなる混合物に、所定量の水を加えて、加水分解・縮合反応を行う方法。

2) (A)成分を構成する化合物(1)~(3)、アルカリ触媒および有機溶媒からなる混合物に、所定量の水を連続的あるいは断続的に添加して、加水分解、縮合反応を行う方法。

3) (A)成分を構成する化合物(1)~(3)および有機溶媒からなる混合物に、所定量の水およびアルカリ触媒を加えて、加水分解・縮合反応を行う方法。

4) (A)成分を構成する化合物(1)~(3)および有機溶媒からなる混合物に、所定量の水およびアルカリ触媒を連続的あるいは断続的に添加して、加水分解、縮合反応を行う方法。

5) 有機溶剤、水およびアルカリ触媒からなる混合物に、所定量の(A)成分を構成する化合物(1)~(3)を加えて、加水分解・縮合反応を行う方法。

6) 有機溶剤、水およびアルカリ触媒からなる混合物に、所定量の(A)成分を構成する化合物(1)~(3)を連続的あるいは断続的に添加して、加水分解・縮合反応を行う方法。

7) 有機溶剤、水およびアルカリ触媒からなる混合物に、所定量の(A)成分を構成する化合物(1)~(3)を加えて、加水分解・縮合反応を行い、pH調整剤を添加する方法。

8) 有機溶剤、水およびアルカリ触媒からなる混合物に、所定量の(A)成分を構成する化合物(1)~

(3)を加えて、加水分解・縮合反応を行い、溶液の一

定濃度に濃縮した後pH調整剤を添加する方法。

9) 上記1)~8)の方法で得られた溶液に(B)成分を添加する方法。

10) 上記1)~8)の方法で、化合物(1)~(3)と(B)成分を同時に添加する方法。

11) 上記1)~10)の方法で得られた溶液を、別な有機溶剤で抽出する方法。

12) 上記1)~10)の方法で得られた溶液を、別な有機溶剤で置換する方法。

13) 上記1)~10)の方法で得られた溶液を、別な有機溶剤で抽出した後、更に別な有機溶剤で置換する方法。

14) 上記1)~13)の方法で得られた溶液に(B)成分を添加する方法。

【0049】このようにして得られる本発明の組成物の全固形分濃度は、好ましくは、2~30重量%であり、使用目的に応じて適宜調整される。組成物の全固形分濃度が2~30重量%であると、塗膜の膜厚が適当な範囲となり、保存安定性もより優れるものである。なお、この全固形分濃度の調整は、必要であれば、濃縮および上記(C)有機溶剤による希釈によって行われる。

【0050】本発明の組成物を、シリコンウエハ、SiO<sub>2</sub>ウエハ、SiNウエハなどの基材に塗布する際には、スピンコート、浸漬法、ロールコート法、スプレー法などの塗装手段が用いられる。

【0051】この際の膜厚は、乾燥膜厚として、1回塗りで厚さ0.05~2.5μm程度、2回塗りでは厚さ0.1~5.0μm程度の塗膜を形成することができる。その後、常温で乾燥するか、あるいは80~600℃程度の温度で、通常、5~240分程度加熱して乾燥することにより、ガラス質または巨大高分子の絶縁膜を形成することができる。この際の加熱方法としては、ホットプレート、オーブン、ファーンズなどを使用することが出来、加熱雰囲気としては、大気下、窒素雰囲気、アルゴン雰囲気、真空下、酸素濃度をコントロールした減圧下などで行うことができる。また、電子線や紫外線を照射することによっても塗膜を形成させることができる。また、上記塗膜の硬化速度を制御するため、必要に応じて、段階的に加熱したり、窒素、空気、酸素、減圧などの雰囲気を選択することができる。このようにして得られる本発明のシリカ系膜は、膜密度が、通常、0.35~1.2g/cm<sup>3</sup>、好ましくは0.4~1.1g/cm<sup>3</sup>、さらに好ましくは0.5~1.0g/cm<sup>3</sup>である。膜密度が0.35g/cm<sup>3</sup>未満では、塗膜の機械的強度が低下し、一方、1.2g/cm<sup>3</sup>を超えると低比誘電率が得られない。また、本発明のシリカ系膜は、BJH法による細孔分布測定において、10nm以上の空孔が認められず、微細配線間の層間絶縁膜材料として好ましい。さらに、本発明のシリカ系膜は、吸水性が低い点に特徴を有し、例えば、塗膜を127℃、2.5atm、100%RHの環境に1時間放置した場合、

放置後の塗膜のIRスペクトル観察からは塗膜への水の吸着は認められない。この吸水性は、本発明における膜形成用組成物に用いられる化合物(1)のテトラアルコキシシラン類の量により、調整することができる。さらに、本発明のシリカ系膜の比誘電率は、通常、2.6~1.2、好ましくは2.5~1.2、さらに好ましくは2.4~1.2である。

【0052】このようにして得られる層間絶縁膜は、焼成条件による比誘電率の差異が小さく、かつクラック耐性に優れることから、LSI、システムLシ、DRAM、SDRAM、RDRAM、D-RDRAMなどの半導体素子用層間絶縁膜やエッチングストッパー膜、半導体素子の表面コート膜などの保護膜、多層レジストを用いた半導体作製工程の中間層、多層配線基板の層間絶縁膜、液晶表示素子用の保護膜や絶縁膜などの用途に有用である。

装置：東ソー(株)製、GPCシステム モデル GPC-8020

東ソー(株)製、カラム Alpha5000/3000

ビスコテック社製、粘度検出器および光散乱検出器

モデル T-60 デュアルメーター

キャリア溶液：10mMのLiBrを含むメタノール

キャリア送液速度：1ml/min

カラム温度：40℃

#### 【0055】比誘電率

8インチシリコンウエハ上に、スピンコート法を用いて組成物試料を塗布し、ホットプレート上で90℃で3分間、窒素雰囲気200℃で3分間基板を乾燥し、さらに390℃ならびに440℃の窒素雰囲気ホットプレートで30分基板を焼成した。得られた膜に対して、蒸着法によりアルミニウム電極パターンを形成させ比誘電率測定用サンプルを作成した。該サンプルを周波数100kHzの周波数で、横河・ヒューレットパッカード(株)製、HP16451B電極およびHP4284AブレンジョンLCRメータを用いてCV法により当該塗膜の比誘電率を測定した。

#### 【0056】クラック耐性

8インチシリコンウエハ上に、スピンコート法を用いて組成物試料を塗布し、ホットプレート上で90℃で3分間、窒素雰囲気200℃で3分間基板を乾燥し、さらに390℃ならびに440℃の窒素雰囲気ホットプレートで30分基板を焼成した。この際の膜厚は2.1μmとした。得られた塗膜の一部をナイフで傷を付け、純水中に40時間浸漬した。塗膜中のナイフの傷跡を顕微鏡で観察し、以下の基準で評価した。

○：クラックの伝播認められない。

×：クラックの伝播認められる

#### 【0057】

#### 【0058】合成例1

石英製セパラブルフラスコに、蒸留エタノール570g、イオン交換水160gと10%ジメチルアミン水溶

#### \*【0053】

【実施例】以下、本発明を実施例を挙げてさらに具体的に説明する。ただし、以下の記載は、本発明の態様例を概括的に示すものであり、特に理由なく、かかる記載により本発明は限定されるものではない。なお、実施例および比較例中の部および%は、特記しない限り、それぞれ重量部および重量%であることを示している。また、各種の評価は、次のようにして行なった。

#### 【0054】慣性半径

10 下記条件によるゲルパーミエーションクロマトグラフィー(GPC)(屈折率、粘度、光散乱測定)法により測定した。

試料溶液：シラン化合物の加水分解縮合物を、固形分濃度が0.25%となるように、10mMのLiBrを含むメタノールで希釈し、GPC(屈折率、粘度、光散乱測定)用試料溶液とした。

液90gを入れ、均一に攪拌した。この溶液にメチルトリメチルシラン13.6gとテトラエトキシシラン20.9gの混合物を30分間かけて添加した。溶液を65℃に保ったまま、2時間反応を行った。この溶液にブロビレングリコールモノメチルエーテルアセテート3000gを加え、その後、50℃のエバポレーターを用いて溶液を10%(完全加水分解縮合物換算)となるまで濃縮した。この溶液10%マレイン酸のブロビレングリコール溶液を添加し、溶液のpHを4とすることで反応液①を得た。このようにして得られた縮合物等の慣性半径は、14.3nmであった。

#### 【0059】比較合成例1

合成例1において、10%メチルアミンの代わりにコハク酸2.4gを使用した以外は合成例1と同様にして反応液②を得た。このようにして得られた縮合物等の慣性半径は、0.2nmであった。

#### 40 【0060】実施例1

合成例1で得られた反応液①100gにN、O-ビス(トリメチルシリル)アセトアミド0.5gを添加し0.2μm孔径のテフロン(登録商標)製フィルターでろ過を行い本発明の膜形成用組成物を得た。得られた組成物をスピンコート法でシリコンウエハ上に塗布した。390℃焼成の塗膜の比誘電率は2.22、440℃焼成の塗膜の比誘電率は2.23と比誘電率の焼成依存は非常に小さかった。また、390℃焼成ならびに440℃焼成の塗膜のクラック耐性も良好であった。

#### 50 【0061】実施例2~4

表1に示す組成で膜形成用組成物を作製し、実施例1と同様に評価を行った。評価結果を表1に併せて示す。 \* 【0062】

実施例	反応液	(B)成分	塗膜の比誘電率		塗膜のクラック耐性	
			390℃焼成	440℃焼成	390℃焼成	440℃焼成
1	反応液① 100g	N,O-ビス(トリメチルシリル)アセトアミド 0.5g	2.22	2.23	○	○
2	反応液① 100g	N,O-ビス(トリメチルシリル)アセトアミド 1.5g	2.22	2.22	○	○
3	反応液① 100g	ヘキサメチルジシラン 0.2g	2.24	2.26	○	○
4	反応液① 100g	ヘキサメチルジシラン 0.5g	2.26	2.27	○	○

#### 【0063】比較例1

合成例1で得られた反応液①のみを使用した以外は実施例1と同様にして塗膜の評価を行った。390℃焼成の塗膜の比誘電率は2.24、460℃焼成の塗膜の比誘電率は2.37と比誘電率の焼成依存が生じた。

#### 【0064】比較例2

比較合成例1で得られた反応液②100gにN,O-ビス(トリメチルシリル)アセトアミド0.5g添加したことを使用した以外は実施例1と同様にして塗膜の評価を行った。390℃焼成の塗膜の比誘電率は3.23、※

※440℃焼成の塗膜の比誘電率は2.89と比誘電率の焼成依存が非常に大きかった。また、390℃焼成ならびに440℃焼成の塗膜のクラック耐性を評価したところ、クラックの伝播が認められた。

#### 【0065】

【発明の効果】本発明によれば、アルカリ触媒で加水分解したアルコキシシラン加水分解重合体にシリル化剤を添加することで、焼成条件による比誘電率の差異が小さく、かつクラック耐性に優れた膜形成用組成物（層間絶縁膜用材料）を提供することが可能である。

フロントページの続き

(51)Int.Cl.<sup>7</sup>

識別記号

F I

テーマコード(参考)

C 0 9 D 183/02  
183/14  
H 0 1 L 21/312  
21/316

C 0 9 D 183/02  
183/14  
H 0 1 L 21/312  
21/316

C  
G

(72)発明者 山田 欣司

東京都中央区築地二丁目11番24号ジェイエス  
スアール株式会社内



F ターム(参考) 4G072 AA25 BB09 EE07 GG01 GG03  
HH28 JJ38 KK03 NN21 RR05  
UU01  
4J035 AA02 AB03 BA01 BA11 CA162  
EA01 HA01 HA02  
4J038 DL021 DL031 DL041 DL161  
HA176 JA18 JA20 JA26  
JA28 JA32 JA34 JA56 JA57  
JB01 JB03 JB09 JB25 JB27  
JB30 KA04 KA06 MA07 MA10  
NA11 NA21 PA19 PB09  
5F058 AA02 AA10 AC03 AF04 AG01  
AH02 BA04 BA20 BC05 BF46  
BH01 BJ02

**THIS PAGE BLANK (USPTO)**